

(19)
(12)(KR)
(A)(51) 。 Int. Cl. ⁷
H05B 33/10(11)
(43)2002 - 0000204
2002 01 05(21) 10 - 2000 - 0034654
(22) 2000 06 23

(71) 56

(72) 56

(74)

:

(54)

ELD ELD , ELD
 , ELD
 ,
 LD 가 E
 , 가
 , ELD
 ELD, , , 가 , , ,

[illegible]

ELD

, , ELD

가 1 가 2 ELD ELD

.

,

(Paticle), (Organic) (Meta

Is) (Natrium/Chemical Oxide) HCl H

ELD

ELD , ELD

ELD ELD ELD

ELD 가 ELD ELD

(Laser Ablation)

ELD

nm 200mm² 25 (25sec/200mm²) 가 ELD

(KrF Excimer) , HCl, H

ELD 가 0.09μm 가 , 248

50% 가 , 50%

가

ELD

ELD 가

가 .

가

가 .

- ELD ELD 100% .
- (57)
1. ELD ELD , ELD ; ELD HCl, H ELD ; ELD (Micro - contamination) ELD (Paticle), (Organic) ; 가 ELD .
 2. 1 , 가 HCl, H ELD 가 가 ELD .
 3. 1 , (KrF Excimer) ELD .
 4. 1 , (ArF Excimer) ELD .

专利名称(译)	使用激光和远程等离子体的EL-DI清洁方法		
公开(公告)号	KR1020020000204A	公开(公告)日	2002-01-05
申请号	KR1020000034654	申请日	2000-06-23
[标]申请(专利权)人(译)	Choi Seung RAK Choeseungrak		
申请(专利权)人(译)	Choeseungrak		
当前申请(专利权)人(译)	Choeseungrak		
[标]发明人	CHOI SEUNG RAK		
发明人	CHOI, SEUNG RAK		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	H01L21/02057 H01L2224/83013 H05B33/10		
代理人(译)	李, SOO WOONG		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

目的：提供一种使用激光和远程等离子体清洁ELD的方法，以简化清洁设备，降低清洁成本并缩短清洁时间。 组成：ELD自动转移到清洁空间。 通过使用HCl，H₂源的远程等离子体，通过表面反应或蚀刻ELD的金属污染物，从转移的ELD中除去金属和钠/化学氧化物。 通过发射激光将吸附在ELD上的污染物（如微粒，有机物和离子杂质）等微污染物分离。 将惰性气体喷射到分离出的污染物上，以将污染物排放到外部并去除污染物。 通常使用在其中操作激光器的真空室和在其中具有HCl，H₂源的远程等离子体的真空室。 该激光器是KrF准分子激光器。 否则，激光器可以是ArF准分子激光器。